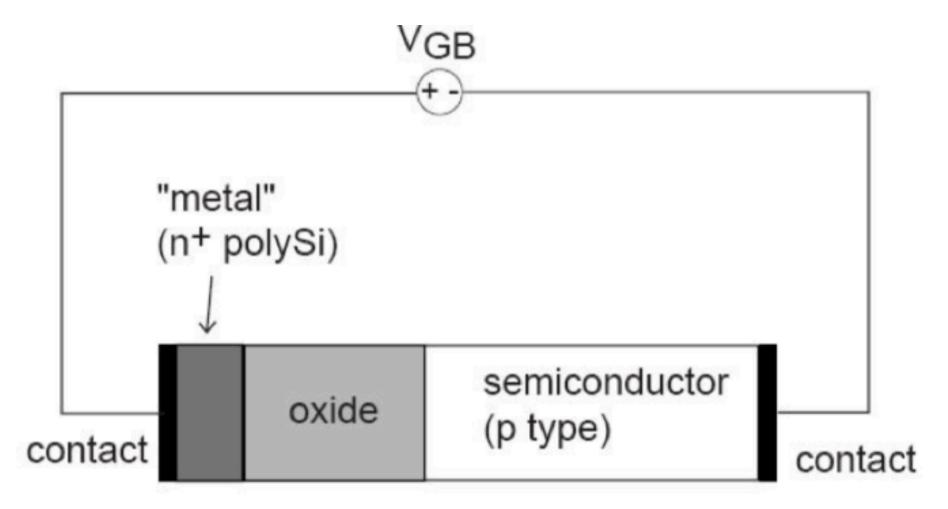
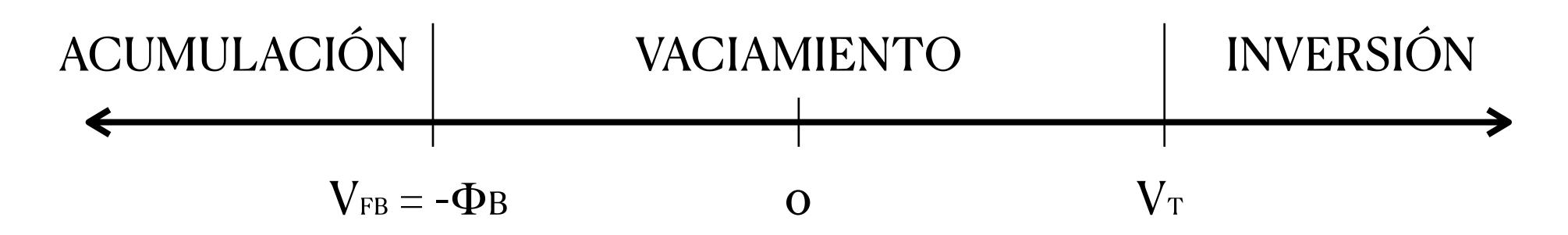
JUNTURA MOS EN INVESIÓN



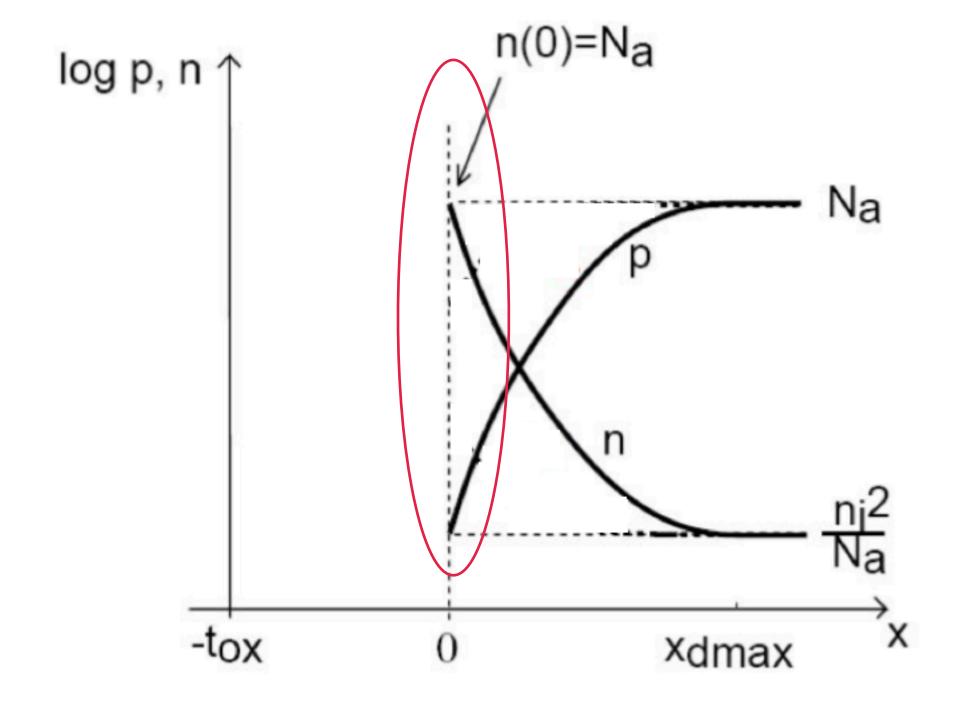
*Para una juntura poly-N y substrato P



CONCENTRACIONES EN LA JUNTURA MOS

CONDICIÓN DE UMBRAL

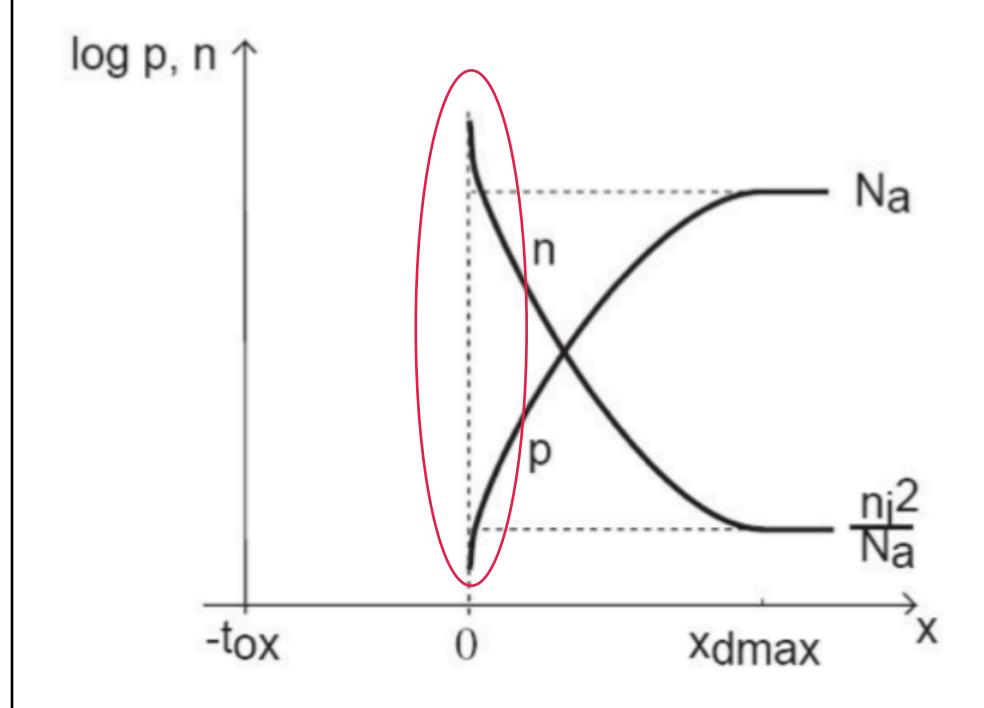
$$V_{GB} = V_{T}$$



V_T: Tensión de umbral

<u>INVERSIÓN</u>

$$V_{GB} > V_{T}$$



FENOMENOS QUE SUCEDEN EN INVERSIÓN

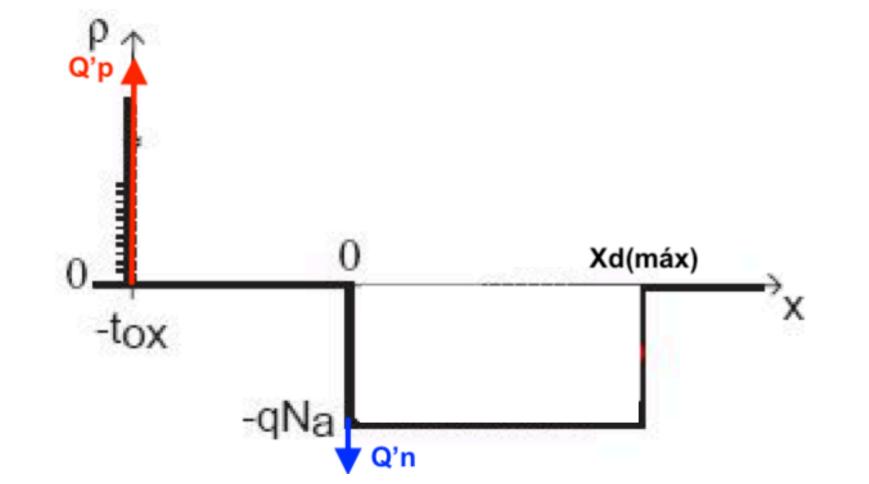
1 - El ancho de la zona de vaciamiento llega a un valor máximo y se vuelve constante. Este valor se alcanza cuando VGB = VT.

$$x_d(inv.) \simeq x_d(V_T) = \sqrt{\frac{2\epsilon_s(-2\phi_p)}{qN_a}} = x_{dmax}$$

2 - La diferencia de potencial en el substrato alcanza un valor constante.

$$V_B(inv.) \simeq V_B(V_T) = -2\phi_p$$

3 - Comienza a acumularse carga de forma superficial en la interfaz óxido semiconductor, de signo negativo.



$$|Q'p| = |Q'n| + qNax_{d(max)}$$

Q'n: carga de inversión

$$Q_n' = -C_{ox}'(V_{GB} - V_T)$$

Utilizando los mismos datos que en el ejercicio anterior pero ahora aplicando una tensión V_{GB} = 2V. Obtener el ancho de la zona de vaciamiento (xd), las diferencias de potencial en el óxido (ΔV ox) y en el sustrato (ΔV subs) y la carga de inversión (Q'n).

Datos:
$$t_{ox} = 150 \ 10^{-10} m = 150 \ 10^{-8} cm$$
 $N_A = 3 \ 10^{15} \ cm^{-3}$ $V_{FB} = -0.876 \ V$ $V_T = 0.884 \ V$ $V_{GB} > V_T$ => INVERSIÓN

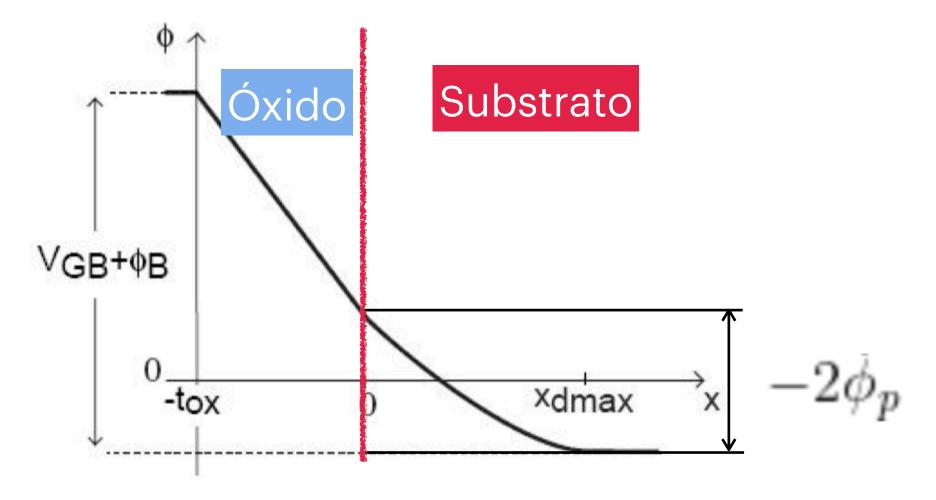
1) Obtenemos el valor de Xd

$$x_d = x_{dmax} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s(-2\phi_p)}{qNa}} = 5.30 \, 10^{-5} cm$$

$$\phi_p = V th \ln\left(\frac{N_A}{ni}\right) = 326 mV$$

2) Obtenemos las diferencias de tensión en el óxido y en el substrato

$$\Delta V_{Susb} = -2\phi_p = 2.326 \, mV = 652 \, mV$$



Como es un circuito cerrado debe cumplir la ley de Kirchhoff de tensión

$$V_{GB} + \phi_B = \Delta V_{ox} + \Delta V_{Subs} \qquad \phi_B = -V_{FB} = 0.876V$$

$$\Delta V_{ox} = V_{GB} + \phi_B - \Delta V_{Subs} = 2,22V$$

Utilizando los mismos datos que en el ejercicio anterior pero ahora aplicando una tensión V_{GB} = 2V.

Datos:
$$t_{ox} = 150 \ 10^{-10} m = 150 \ 10^{-8} cm$$
 $N_A = 3 \ 10^{15} \ cm^{-3}$ $V_{FB} = -0.876 \ V$ $V_T = 0.884 \ V$

3) Obtenemos el valor de Q'n

$$Q'_n = -C'_{ox}(V_{GB} - V_T) = -\frac{\varepsilon_{SiO_2}}{t_{ox}}(2V - 0, 884V)$$

SIEMPRE Y CUANDO VGB > VT (INVERSIÓN)

$$Q_n' = -2,301\,10^{-7}C/cm^2$$